講座 核融合炉材料研究における透過型電子顕微鏡 (TEM)

2. TEM で視る核融合炉材料の照射損傷

2. TEM Observation of Radiation Damage in Fusion Reactor Materials

橋本直幸 HASHIMOTO Naoyuki 北海道大学大学院工学研究院 (原稿受付:2024年11月5日)

核融合炉照射環境における構造材料の損傷機構を理解するため,透過型電子顕微鏡(TEM)を用いた微細組 織変化の観察・解析手法について,低放射化フェライト・マルテンサイト鋼を例に解説を試みた.照射導入点欠 陥の離合集散によって材料中に形成する欠陥クラスターは,格子間原子(I)型と空孔(V)型に大別され,それ ぞれ電子線の入射方位や反射ベクトル,フォーカスなど,適切な観察条件を選択して初めて適切な微細組織観察 像となり得る.

Keywords:

radiation damage, point defects, cluster, dislocation loop, transformation, cavity, reduced activation ferritic/martensitic steel

2.1 はじめに

現在,水冷却型軽水炉構造材料として,FCC構造のオー ステナイトステンレス鋼(あるいはBCC構造の低合金鋼) が広範に使用されているが、オーステナイトステンレス鋼 は、スウェリング、照射促進応力腐食割れ、破壊靭性の低 下、照射誘起偏析などが生じ、高温かつ高照射量の次世代 エネルギー炉システムには不適とされる[1-5]ことから. 重照射を受ける核融合炉第一壁の構造材料に対しては、高 温でより耐照射性に優れた低放射化フェライト・マルテン サイト鋼 (RAFM) の使用が考えられている. 核融合炉 構造材料は、基本的に、照射によって導入された点欠陥(原 子空孔: V及び格子間原子: I) を介した溶質原子の移動や 局所的な溶質濃度変化に起因した劣化が生じるが、照射下 での溶質原子の挙動については未だ不明な要素が多い.本 稿では、核融合炉照射環境における RAFM の損傷機構を 理解するため、組織学的なアプローチとして、透過型電子 顕微鏡(TEM)を用いた損傷組織変化の観察・解析手法 について解説する.

2.2 RAFM における照射損傷

RAFMが中性子やγ線を受けた場合,放射線と金属原 子との間に様々な物理的相互作用が生じるが,特に,中 性子エネルギーによる弾き出し(displacement)と核変 換(transformation)は金属材料の照射損傷挙動に多大な 影響を及ぼす.弾き出しと核変換によって生成した点欠陥 (point defect)とHe(α粒子)やH(陽子)は,照射下 という非平衡状態で相互作用しながら消滅,拡散,集合体 形成を繰り返し,材料のミクロ組織変化と機械的特性変化 が生じる主要因として振舞う.

2.2.1 弾き出し損傷

中性子エネルギーによる弾き出し損傷は、金属原子核が 中性子との衝突により運動エネルギーを受け取り、結晶格 子位置から離れて運動する現象であり、その結果、VとI が生成する. この1対の点欠陥をフレンケル対 (Frenkel pair) と呼ぶ. 一方, 核変換では(n, α) 及び(n, p) 核反応 により、材料中に存在しなかったHeやHが発生すると ともに金属原子自体が別の各種に変化する. 中性子と衝 突して最初に動き出す原子を一次弾き出し原子 (PKA: Primary Knock-on Atom) と呼ぶ. 1 MeVの中性子から PKAが受け取るエネルギーの平均値はおよそ40 keVであ り、例えば、Fe原子一個を弾き出すのに必要なエネルギー (弾き出しエネルギー, displacement energy): 40 eVと 比較して1000倍程度高いため、PKAからFe原子同士の 衝突が連鎖的に発生する. このような連鎖的な弾き出し による損傷をカスケード損傷(cascade damage)と呼称 し、その結果点欠陥が密集した領域をカスケードと呼ぶ. 通常,カスケード中心部にV,外側には多数のIが存在し, この時点で形成されているIの集合体は、TEMによって 観察可能なサイズ (>1 nm) となる.

2.2.2 ミクロ組織の発達

照射下では、同種の点欠陥が集合して集合体(クラス ター:cluster)を形成する.体心立方(BCC)型結晶材 料では、集合体としてブラックドット、転位ループ、キャ ビティ(Heバブル及びボイド)、析出物などが挙げられる. さらに、集合体は点欠陥のシンクとしても働き、同種の点 欠陥を吸収することで成長し、異種の場合は収縮する.ま

Laboratory of Advanced Materials, Faculty of Engineering, Hokkaido University, Sapporo, HOKKAIDO 060-8628, Japan

author's e-mail: hasimoto@eng.hokudai.ac.jp

た,集合体が点欠陥を放出する確率は温度に依存し,高温 ほど起こりやすくなる.言い換えれば,集合体からの空孔 の放出は空孔の可動温度領域でなければ生じ得ない.

2.2.2.1 ミクロ組織の形成

2.2.2.1.1 照射下における点欠陥の挙動

照射による材料特性の変化は、弾き出しによるV及びI の生成と点欠陥の拡散、点欠陥集合体の形成が基礎とな る.Iの形成エネルギーは数eVであり、高温に置いても 熱平衡濃度は極めて小さいが、照射下ではVと同数だけ弾 き出され、材料中に過飽和に存在する.また、移動エネル ギーが小さいため、室温のような低温であっても容易に拡 散し、集合体(転位:dislocation)を形成して材料内に蓄 積する.一方.Vの形成エネルギーは1.5 eV程度であるた め、高温では熱平衡濃度が高く、高温での拡散や変形(ク リープ)などを誘発する.

弾き出しにより生成した点欠陥は、基本的に、対消滅、 粒界などの吸収源(シンク: sink)への吸収、集合体形成 のいずれかの道をたどる、VとIの濃度 C_v 、 C_i の時間変化 は、それぞれの拡散速度を D_v 、 D_i 、空孔の熱平衡濃度を C_v^{e} 、生成速度をP、対消滅反応定数をR、シンク濃度を C_s とし、

$dC_v/dt = P - RC_vC_i - D_v(C_v - C_v^{e})C_s$	(1)
$dC_i/dt = P - RC_vC_i - D_iC_iC_s$	(2)

と表される[6]. この解は温度やシンク濃度に依存するが, $D_i \gg D_v$ であるため、Iは早めにシンクで消滅し、熱平衡以 上のV(過飽和空孔)が蓄積されて定常状態になる.した がって、照射下では通常、熱平衡濃度以上のVが常に存在 するため、熱拡散がほとんど無視できる温度領域であって も、照射促進拡散(radiation enhanced diffusion)と言 われるVを介した原子の拡散が起こる.式(1)及び式(2) からわかるように、照射下における点欠陥濃度は生成速 度、シンク濃度、拡散速度、温度に強く依存するため、熱 平衡状態における拡散と照射下における拡散を区別するこ とは困難であり、このことはつまり、照射下で観られる現 象は非照射における現象とは別の状態であると理解すべき ことを意味する.

2.2.2.1.2 格子間原子型欠陥集合体(転位成分)

照射したRAFM中に観察される転位には、ブラックドッ ト(black dot),転位ループ(dislocation loop),ネットワー ク転位(network dislocation)がある.このうち、照射に より新たに形成する転位成分は、ブラックドット及び転位 ループである.ブラックドット及び転位ループは、BCC の(100)面上にIが平面的(2次元的)に集合したもので ある.これに対し、Vが2次元的に集合すると1原子面不 足(intrinsic)した状態の積層欠陥ループとなる.図1に TEMで撮影したBCC材料中の転位ループを示す.これら の転位はバーガースベクトル(Burgers vector)で定義さ れ、バーガースベクトルの方向がすべり方向で大きさが面 間隔と一致している場合は完全転位である.BCC中に形 成した転位ループは $b = a\langle 110 \rangle$ のバーガースベクトルを有 する.また、ブラックドットはTEMで黒点状に観察され



図1 被照射 BCC 材料中の(100)面上に形成した転位ループ. (図中の線文状の黒いコントラスト)電子ビーム入射条件: B ≒ [011], g = 200.

る黒点であり, 歪場を有することから欠陥クラスターであ ると判断されるが, 極めて微細であることから実体の判定 には注意が必要である[2]. これら各種転位は, 材料変形 に必要な転位線の運動に対する障害物として作用し, 転位 線をピン止めする. その結果, 材料の降伏強度が上昇し, 所謂照射硬化の要因となる. したがって, 可能であれば照 射損傷組織として発達しないことが望ましい.

2.2.2.1.3 格子間原子型欠陥集合体のTEM 観察

BCC構造を有する鉄系材料では、中性子照射によって 弾き出されて生き残ったIがI型クラスターを形成し、成 長と共に転位ループへと変化する.このI型クラスターの TEM観察には、通常、ひずみの芯が鮮明に観察可能な弱 ビーム暗視野法(Weak-Beam Dark Field)を用いる.

図2に, 試料を透過した電子線の透過波と回折波の経路 を模式的に示した.

試料中に入射して回折した電子線は、コンデンサーレ ンズにより後焦点面(Back Focal Plane)において一旦 収束し、回折像(Diffraction Image)を形成する.ここ で入射波を選択して結像すれば明視野像(Bright Field Image)が得られ、回折像を選択すれば暗視野像(Dark Field Image)が得られる.一方、回折像には菊池図形 (Kikuchi pattern)と呼ばれる入射電子線の方向を精確に 表す図形が現れる.菊池図形は白黒一対の平行線からな り、それぞれが結晶中の(hkl)面と(h(-)k(-)l(-))面



図2 試料を透過した電子線の透過波と回折波の経路.

に対応している. (*hkl*)面でブラッグ反射を起こした電子 線は(*hkl*)面の法線を中心とし, (90 – θ)。の半角を有する 円錐状に広がる (**図**3). 菊地線は結晶の僅かな傾きによ りその位置を大きく変えるため, この手法を用いてクラス ター及び転位ループの芯を鮮明に結像することができる. **図**4 は菊地線を利用してビームの反射条件を適切に選択し て結像させた明視野像: BF (3g励起)及び弱ビーム暗視 野像: WBDF (g/5g) であり, 微小サイズのクラスター が鮮明に結像される.

2.2.2.1.4 核変換によるHe及びHの生成

核変換により生成するHeやHの濃度は、材料の各構成 元素における(n, α)及び(n, p)のような核反応すべてにつ いて反応断面積を用いて算出する.熱中性子に対して断 面積が大きいのは、¹⁰B(n, γ)と¹⁴N(n, p)反応であるが、 ⁵⁸Niの2段階反応⁵⁸Ni(n, γ) ⁵⁹Ni(n, α) ⁵⁶Feと⁵⁸Ni(n, γ) ⁵⁹Ni(n, p) ⁵⁹CoはそれぞれHeとHの生成に大きく寄与す る[7].

HeやHは点欠陥との相互作用により中性子照射下のミ クロ組織変化に大きな影響を及ぼす[8,9]. Heは金属材料 中ではほとんど固溶しないため、核変換により多量に導 入されると、ヘリウムバブル(He babble)の形成やV型 集合体の安定化に寄与し、さらには結晶粒界に偏析して 材料の脆化を引き起こす要因となる. Hは非常に拡散し やすい元素であるが、点欠陥、特にVに容易に捕獲(ト ラップ)され、V型集合体の形成・成長挙動に多大な影響



 図3 (*hkl*) 面の法線を中心として円錐状に広がるブラッグ反射 を起こした電子線(Kossel Cone)の概略図.
Kossel Cone とエワルド球の交線が菊地線となる.



 図 4 菊地線を利用し、電子ビームの反射条件を適切に選択して 結像させた BF 像(3g 励起)及び WBDF 像(g/5g). を及ぼす. V型集合体が形成し, その後さらに空孔を吸収 すれば, TEM観察可能なサイズ (>1 nm) まで成長して キャビティ (cavity) となり, 材料の体積膨張 (スウェリ ング: swelling) が生じることになる. また, HeやHの 材料への影響を考える場合, それらの生成量と弾き出し損 傷との比率である He/dpaやH/dpaが評価指標として用い られる. なお. 空孔型クラスター (微小キャビティ, ボイ ド, バブル等)の観察は, 基本的にフォーカスの調整に依 る. 図5に. 中性子照射したRAFM中に観察されたキャ ビティを示しており, 左図はアンダーフォーカス像, 右図 はオーバーフォーカス像である. キャビティのコントラス トは, アンダーフォーカス条件では白く, オーバーフォー カス条件で黒く観察される. これは, TEM観察における フリネルフリンジのコントラストと同様の現象と理解され ている.

2.2.2.1.5 空孔型欠陥集合体のTEM 観察

キャビティとは材料中の3次元的な空洞を指し,実態は Heバブルや空孔集合体のボイド (void) である.図6に 中性子照射したRAFM中に形成したキャビティのTEM像 を示す.転位はVよりもIを吸収しやすいバイアス (bias) を有するため,転位ループの形成・成長に伴いVが材料中 に過剰に蓄積され,V集合体を形成することになる.この とき,核変換生成物であるHeはV集合体を安定化させ, さらに多量に存在する場合には,V集合体内部に存在して Heバブルとして析出する.一般に,低温で形成したバブ ルは内圧が高いため球形であり,一方,ボイドは特定の結 晶面に囲まれた矩形の傾向にある.高温で転位のIに対す るバイアスが有効で,Vが過剰に存在する場合には,ボイ



図 5 被照射 RAFM 中に形成したキャビティ 左図:アンダー フォーカス像,右図:オーバーフォーカス像.



Fe³⁺+He⁺+H⁺照射



図6 被照射 RAFM 中に形成したキャビティ(ボイド:多角形 状の白いコントラスト,ヘリウムバブル:微小円状の白い コントラスト). He 原子 により早期に安定化した空孔型ク ラスターは微小サイズのヘリウムバブルとなり,H原子の 助けを借りて大きなサイズに成長する. Lecture Note

ドが安定的に成長する.ボイド形成には原子空孔の移動が 伴うため,低温では点欠陥の再結合(recombination)が 律速となり,ボイド形成が起こらない.一方,高温では点 欠陥の拡散が律速となり,ボイドからVの熱放出が活発化 するため,ボイドの成長が停滞する.この結果,ボイドの 形成・成長は中間温度領域でピークとなる[10-12].キャ ビティの形成は,総体積に相当するスウェリングを起こし て構造材料の寸法安定性や破壊特性に悪影響を及ぼすこと が知られているため,高温で使用する場合には,特に注意 が必要である.これらキャビティやバブルなどのV型集合 体も,転位同様,運動転位の障害物として作用して材料の 機械的特性を変化させるため,可能な限り抑制する必要が ある.

図6では、キャビティ(ボイド及びHeバブル)の分 布が不均一であり、特に粒界近傍でキャビティ欠乏帯 (Defect free zone: DFZ)の存在点が確認できる.欠陥に 対する粒界のシンク強度を調査するため、適切な条件で熱 処理した転位フリーなRAFMに対して電子線照射その場 観察実験を行った結果、境界からの距離の関数としてキャ ビティの勾配分布が観察された.DFZの幅を決定する重 要なパラメータとして粒界面の原子密度比[13]が提案され ており、原子密度比が高い粒界は、通常、原子密度比が低 い粒界と比較して、DFZが拡大する傾向にある.これら の結果は、RAFMの照射誘起二次欠陥の分布は均一では なく、粒界面の原子密度比によって特徴付けられるシンク 強度によって制御される可能性が高いことを明確に示して いる.

2.2.2.1.6 析出物

析出物(precipitate)は、元素組成や結晶構造が母相 とは異なる相(phase)である. 図7に、電解研磨により 薄膜化したRAFM 試料のSEM像を示す. 熱平衡条件下で は熱力学的に安定な相が決まっているが、照射下では点欠 陥が非平衡的に過剰に導入されるため、相変化が促進(照 射促進析出: radiation enhanced precipitation)あるい は誘起(照射誘起析出: radiation induced precipitation) されることがある[13,14]. RAFMは、通常、高温で一定 時間保持したあと焼き入れ・焼戻し処理が行われるため、



図7 表面を電解研磨した RAFM 試料の SEM 像. 析出物(図中 の白い点状のコントラスト)が粒界に沿って高密度に分布 していることが確認できる.

熱力学的には安定状態である.しかしながら,長時間中性 子照射環境で保持すれば,熱力学的に存在しない温度領 域における析出[14,15]や,熱時効よりも短時間での析出 [16]が起こり得る.

2.3 おわりに

核融合炉材料,特にRAFMにおける照射損傷機構を理 解するため,照射によって過飽和に導入される点欠陥に起 因する欠陥クラスターのTEM観察手法について,実例を 示しながら解説した.欠陥クラスターは,中性子照射のカ スケード損傷領域近傍に形成する空孔及び格子間原子の微 小集合体から始まり,引き続き導入される点欠陥を吸収し 成長して初めてTEMによって観察可能となる.したがっ て,TEM観察に至るまでの様々な現象については,計算 科学やより分解能の高い別の手法に頼らざるを得ないこと を認識しておく必要がある.

参 考 文 献

- [1] T. Yang et al., J. Mater. Res. 33, 19, Oct 14 (2018).
- [2] M.L. Jenkins and M.A. Kirk, Characterization of Radiation Damage by Transmission Electron Microscopy, Series in Microscopy in Materials Science (CRC Press, 2001).
- [3] G.E. Lucas, J. Nucl. Mater. 206, 287 (1993).
- [4] F.A. Garner, Materials Science and Technology, Vol. 10A, Nuclear Materials, Part 1, Chapter 6, VCH 1994.
- [5] J-C. van Duysen *et al.*, Effects of Radiation on Materials: 16th Int. Symp., ASTM STP 1175, ASTM, p.747, 1993.
- [6] 石野 葉:照射損傷,原子力工学シリーズ8(東京大学 出版会,1979).
- [7] L.R. Greenwood and F.A. Garner, J. Nucl. Mater. 233-237, 1530 (1996).
- [8] B.N. Singh and H. Trinkaus, J. Nucl. Mater. 186, 153 (1992).
- [9] N. Sekimura *et al.*, J. Nucl. Mater. **191-194**, 1234 (1992).
- [10] F.A. Garner et al., 6th Int. Symp. On Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems-Water Reactors, The Minerals, Metals, and materials Society, Warrendale, PA 783-790 (1994).
- [11] J.P. Foster et al., J. Nucl. Mater. 224, 207 (1995).
- [12] D.J. Edwards et al., J. Nucl. Mater. 317, 32 (2003).
- [13] N. Hashimoto *et al.*, Mater. Charact. **207**, 114448 (2024).
- [14] P.J. Maziasz, J. Nucl. Mater. 205, 118-145 (1993).
- [15] P.J. Maziasz and C.J. McHargue, Int. Materials Rev. 32, 190 (1987).
- [16] S.J. Zinkle et al., J. Nucl. Mater. 206, 266 (1993).

